

SCCJ研究会募集

「目指せ分散マイスター！～分散の底力はすごかった～」

※35歳未満の方へご案内ください

2018年度日本化粧品技術者会「研究会」のご案内です。

この「研究会」は次世代を担う若手(35歳未満)化粧品技術者に、化粧品技術やポリシーを伝承し、技術者間の交流を深め、次世代の化粧品産業を支える人材を育成することを目的としています。

主に対象者は35歳未満の化粧品技術者の方とし、正会員、準会員、コスメ倶楽部会員の方がご参加いただけます。また、35歳以上の正会員の方は、ぜひ若手(35歳未満)の方にご案内ください。非会員の方でも「正会員の代理枠」でご参加になれます。

今年度は「目指せ分散マイスター！～分散の底力はすごかった～」をテーマとします。

「分散技術」は化粧品開発に必須の技術です。特に粉体を均一に分散させる技術は色むらや凝集物を防止するだけでなく、使用性や機能性に大きく影響します。ファンデーションやUVプロテクターはもとより、口紅やネイルエナメル、マスカラなど幅広い化粧品を支えています。

今年度は「分散の基礎技術」と「分散技術の処方開発への応用」を2回シリーズ(43回【10月】、44回【12月】)で開催します。分散技術の第一人者が、技術ポイントを開発秘話や技術ポリシーを交えてご紹介します。

講演後、テーブル単位でのグループディスカッションを行い理解を深めます。さらに会場を移して若手技術者間の交流を深めるための交流討論会を実施します。

《43回研究会》

【日程】10月4日(木) 13:30-18:30(受付開始13:00)

【講演内容】「基礎技術、表面処理技術」

一分散の基礎理論や原料開発における基礎技術を伝授します

講演Ⅰ「粉体粒子の分散技術の基礎と表面改質による新しい分散技術の開発」

講師 大東化成工業(株) 常務取締役 田中 巧 氏

講演Ⅱ「表面処理顔料の開発と製剤への応用 -凝集と分散-」

講師 黒田総合技研(株) 代表取締役 黒田 章裕 氏

《44回研究会》

【日程】12月13日(木) 13:30-18:30(受付開始13:00)

【講演内容】「製剤への応用」

一処方開発における分散技術の活用とハンドリングを伝授します

講演Ⅰ「新素材を軸とした紫外線遮断製剤の高水準化と応用展開」

講師 (株)コーセイ 研究所主任研究員 増淵 祐二 氏

講演Ⅱ「メーキャップ製剤への分散技術の応用と近年の分散性評価技術の動向」

講師 (株)資生堂 アドバンストリサーチセンター主幹研究員 那須 昭夫 氏

《当日スケジュール》

【開催場所】 第43回 学士会館(神田) 2F-201号室
 第44回 学士会館(神田) 2F-202号室

	第43回(10/4)	第44回(12/13)
13:00~	受付	
13:30~13:50	ガイダンス・コスメ倶楽部紹介	
13:50~14:55	講演Ⅰ「粉体粒子の分散技術の基礎と表面改質による新しい分散技術の開発」 ー分散の基礎理論、特に表面処理を利用した粉体粒子の分散を学ぶ 大東化成工業(株) 田中 巧 氏	講演Ⅰ「新素材を軸とした紫外線遮断剤の高水準化と応用展開」 ーUVプロテクターやファンデーションにおける分散技術の活用を学ぶ (株)コーセー 増淵 祐二 氏
14:55~16:00	講演Ⅱ「表面処理顔料の開発と製剤への応用 ー凝集と分散ー」 ー原料開発における基礎から応用について学ぶ 黒田総合技研(株) 黒田 章裕 氏	講演Ⅱ「メーキャップ製剤への分散技術の応用と近年の分散性評価技術の動向」 ーメーキャップ製品における分散技術の活用を学ぶ (株)資生堂 那須 昭夫 氏
16:00~16:10	休憩	
16:10~17:10	分散の基礎技術に関するディスカッション	分散の処方開発に関するディスカッション
17:10~17:30	アンケート・移動	
17:30~18:30	交流討論会	

＜申込方法＞

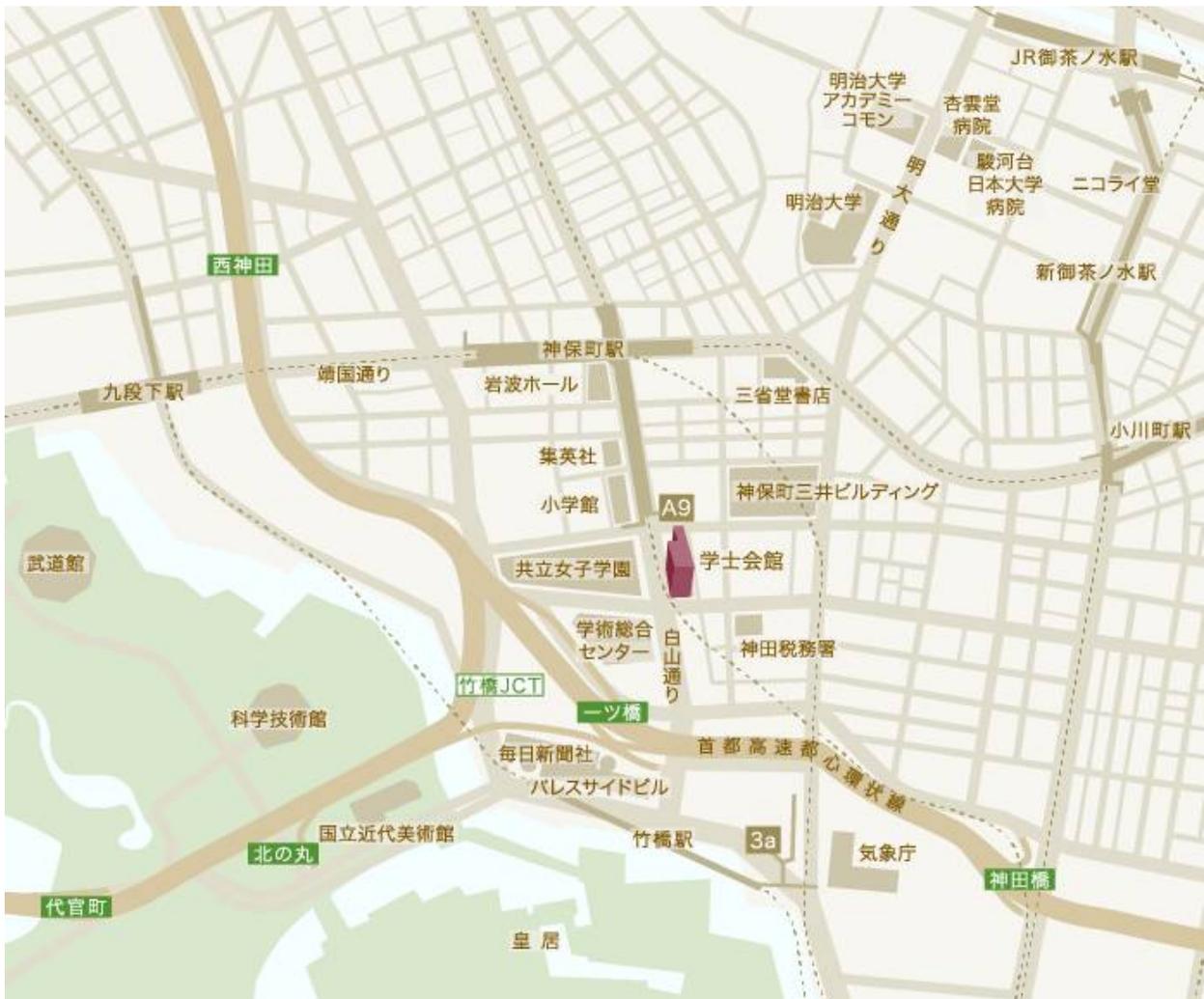
- 1) 別紙の「参加申込書」にて、事務局までFAXしてください。
- 2) 申込対象者 ・研究、製造、商品開発など実務に携わっている35歳未満の会員が対象です。
 ・準会員の方は、ご本人は参加できますが、代理者はたてられません。
 ・35歳以上の正会員の方は代理の方(35歳未満)の参加が可能です。
- 3) 募集人員: 70名(各回)
- 4) 参加費: 2回合計6,000円【各回3,000円×2回】(どちらか一方に参加の場合は3,000円)
- 5) 申込締切: 8月31日(金)
 ただし、定員になり次第締切り(先着申込順)とさせていただきますので、お早めに申込み下さい。
 参加証は折り返しFAXにてご連絡いたします。尚、多数申込みをされた企業の方々には人数調整をお願いする場合がございます。
 ※定員になった場合はホームページ上でお知らせします。申込みの際はご確認ください。
 ホームページ<http://scci-ifsc.com/>
 ※申込み後に、ご都合が悪くなった場合は、早めに事務局までご連絡ください。

「お問合せ先」 日本化粧品技術者会事務局(東日本支部)
 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-11-1 アイオス五反田駅前705
 Tel: 03-6431-9196 Fax: 03-6431-9126

《会場案内》

学士会館 〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28
TEL.03-3292-5936（代表）

- アクセス**
- ・都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線
「神保町」駅下車A9出口から徒歩1分
 - ・東京メトロ東西線「竹橋」駅下車3a出口から徒歩5分
 - ・JR中央線／総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩15分



日本化粧品技術者会事務局(東日本支部) 行

Fax: 03-6431-9126

第43回及び第44回SCCJ研究会

「目指せ分散マイスター！～分散の底力はすごかった～」の事前アンケート

氏名(必須)	
会社名(必須)	
部署名(必須)	
問1(必須) 該当に○ あなたの業務を教えてください。	研究・開発 生産 商品企画 営業 その他
問2(必須) 該当に○ あなたの勤続年数を教えてください。	～2年 2年～5年 5年以上 その他
問3～5については、いずれか、または全てに記載をお願いいたします。	
問3 あなたの組織またはプロジェクトにおける分散技術(分散・表面処理)・UV防御製品およびメイクアップ製剤開発に関連する課題(あるいは課題であった)事例を一つご記載ください	
問4 それはどのように解決する(あるいは解決された)か、具体的にご記載ください	
問5 本研究会で意見交換したいことをご記載ください	
問6 本研究会に期待することをご自由にご記載ください	

10月4日(木)および12月13日(木)開催の第43回・第44回SCCJ研究会「目指せ分散マイスター！～分散の底力はすごかった～」を受講される方に、事前アンケート(必須)をお願いしております。
この事前アンケートは、グループ討議のグループ分けならびに討議内容の事前整理を目的としております。
差支えの無い範囲でご記入いただければ結構です。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【本アンケートで取得した情報の取扱いについて】

- 本アンケートにより取得したデータは、回答内容等について上記の目的に使用いたします。
そのままの形で公表されたり、個人や企業を特定できる形で公表されることはございません。
- 個人情報、日本化粧品技術者会が適正に管理します。
- 詳細については、日本化粧品技術者会のプライバシーポリシーをご覧ください。